### 02

# Границы раздела в сверхпроводниковых гибридных гетероструктурах с антиферромагнитной прослойкой

© К.И. Константинян<sup>1</sup>, Ю.В. Кислинский<sup>1</sup>, Г.А. Овсянников<sup>1,2</sup>, А.В. Шадрин<sup>1,2</sup>, А.Е. Шейерман<sup>1</sup>, А.Л. Васильев<sup>3</sup>, М.Ю. Пресняков<sup>3</sup>, Ф.В. Комиссинский<sup>1,4</sup>

 <sup>1</sup> Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
 <sup>2</sup> Чалмерский технологический университет, Гётеборг, Швеция
 <sup>3</sup> НИЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия
 <sup>4</sup> Дармштадтский университет, Дармштадт, Германия
 E-mail: karen@hitech.cplire.ru

(Поступила в Редакцию 29 августа 2012 г.)

Проведены структурные, рентгеновские и электрофизические исследования гибридных сверхпроводниковых гетероструктур с прослойкой из купратного антиферромагнетика  $Ca_{1-x}Sr_xCuO_2$  (CSCO), где верхним электродом был Nb/Au, нижним — YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> (YBCO). Экспериментально показано, что при эпитаксиальном росте двух купратов YBCO и CSCO образуется граница раздела, на которой происходит обогащение носителями прослойки CSCO на глубину порядка 20 nm. При этом проводимость обогащенной области CSCO, оказывается близкой к металлической, в то время как пленка CSCO, осажденная на подложку из NdGaO<sub>3</sub> является моттовским изолятором с прыжковой проводимостью.

Работа выполнена при поддержке ОФН РАН, Министерством образования и науки РФ, грантом Президента России: Ведущая научная школа НШ-2456.2012.2, проектами РФФИ № 11-02-01234а и 12-07-31207мол\_а, программой Висби Шведского института.

### 1. Введение

В последнее время большой интерес вызывают процессы электронного транспорта, происходящие на границе сверхпроводника (S) с магнетиком (M), где вследствие взаимодействия сверхпроводящих и магнитных корреляций возникает ряд нетривиальных физических явлений [1-4]. Следует заметить, что значительная часть экспериментальных исследований S/M-границ проводилась на металлических или поликристаллических пленках [3-5], в которых нивелируется влияние кристаллической структуры контактирующих материалов. Существенно меньшая по сравнению с металлами длина когерентности оксидных материалов значительно усложняет изготовление оксидных сверхпроводниковых структур с магнитными прослойками. Тем не менее аномальный эффект близости в купратных сверхпроводниках наблюдался в лантановых структурах [6], а в гибридных мезагетероструктурах с антиферромагнитной прослойкой был экспериментально измерен сверхпроводящий ток, имеющий джозефсоновскую природу [7,8]. Определяющее значение для наблюдения перечисленных выше явлений отводится кристаллическим и электрофизическим характеристикам границ раздела контактирующих материалов. В настоящей работе приводятся результаты структурных исследований на просвечивающем электронном микроскопе, рентгеновском дифрактометре, а также электрофизические характеристики гибридных S-M-S' мезагетероструктур (МГС), в которых в качестве S выступал сверхпроводник с s-симметрией параметра порядка — тонкопленочная двухслойная структура Nb/Au, в качестве S'-электрода использовался купратный сверхпроводник YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> (YBCO) с доминирующей d-симметрией параметра порядка, M-прослойкой служил антиферромагнетик Ca<sub>1-x</sub>Sr<sub>x</sub>CuO<sub>2</sub> (CSCO) (x = 0.15 или 0.5).

## 2. Мезагетероструктуры, структурные измерения

Сверхпроводниковая пленка ҮВСО эпитаксиально осаждалась методом лазерной абляции при температуре 700-800° С на подложку (110)NdGaO<sub>3</sub> (NGO). Критическая температура YBCO составляла  $T_C = 88 - 89$  K. Магнитная М-прослойка изготавливалась из купрата  $Ca_{1-x}Sr_xCuO_2$  (x = 0.15 или 0.5), являющегося гейзенберговским антиферромагнетиком. Тонкая (5–50 nm) пленка М-прослойки эпитаксиально выращивалась поверх ҮВСО в той же вакуумной камере при высокой температуре, а потом покрывалась тонким (20–30 nm) слоем золота после охлаждения до комнатной температуры [7]. Купратные пленки YBCO и CSCO обладают близкими кристаллическими параметрами и хорошей химической совместимостью. В ҮВСО параметр базовой плоскости a = 0.3859 nm близок к *a*-параметру CSCO a = b = 0.385 nm. Параметр c = 0.318 - 0.323 nm

Параметр	$\begin{array}{c} \text{CSCP} \\ (x = 0.15) \end{array}$	CSCO/YBCO (x = 0.15)		$\begin{array}{c} \text{CSCO} \\ (x = 0.5) \end{array}$	CSCO/YBCO (x = 0.5)	
	(002) CSCO	(002)CSCP	(007)YBCO	(002)CSCP	(002)CSCO	(007)YBCO
$a_{\perp}, \operatorname{nm} \Delta \omega$	0.321 0.07	0.322 0.2*	1.169 0.2*	0.333 0.4	0.336 0.5*	1.177 0.5*

Кристаллические параметры и ширины кривых качания ( $a_{\perp}$  — межплоскостное расстояние в направлении оси c;  $\Delta \omega$  — ширина кривой качания на уровне полувысоты).

\*Оценка <br/>  $\Delta \Omega$ из 2 $\theta/\omega$ -скана без учета толщины пленки.

в *М*-прослойке изменяется в зависимости от содержания Sr (x = 0.15 или 0.5) [9]. Данные по межплоскостному (в направлении оси *c*) расстоянию  $a_{\perp}$  приведены в таблице. Осаждение поверх *М*-прослойки сверхпроводниковой двухслойной структуры Nb/Au позволяет получить джозефсоновские переходы, СВЧ- и магнитные свойства которых исследовались ранее [10,11]. Топология джозефсоновских переходов в МГС в виде квадрата с линейными размерами  $L = 10-50 \,\mu$ m формировалась методами ионно-лучевого и реактивного травления.

Образцы для исследования поперечного сечения гетероструктуры изготавливались в электронно-ионном микроскопе Helios фирмы FEI (США) с помощью фокусированного ионного пучка энергией  $30 \, \text{kV}$  в начале и  $2 \, \text{kV}$  в конце процесса. Электронно-микроскопические исследования проводились на просвечивающем сканирующем электронном микроскопе TITAN 80-300, оборудованном энергодисперсионным рентгеновским микроанализатором (ЭДРМА), EDAX (США), энергетическим фильтром GIF (Gatan, США) и высокоугловым темнопольным детектором электронов (Fischione, США)



**Рис. 1.** Светлопольное изображение поперечного сечения гетероструктуры Au/CSCO/YBCO/NGO, полученное на просвечивающем электронном микроскопе. На вставке в увеличенном виде показан участок YBCO-пленки.



Рис. 2. Результаты энергодисперсионного рентгеновского микроанализа поперечного сечения участка МГС вблизи границы СSCO/YBCO.

при ускоряющем напряжении 300 kV. Светлопольное изображение поперечного сечения гетероструктуры, полученное с помощью просвечивающего электронного микроскопа, показано на рис. 1. Четко видны границы разделов YBCO/NGO и Au/CSCO. На вставке к рисунку в увеличенном виде показан участок пленки YBCO. Результаты микроанализа состава (ЭДРМА), приведенные на рис. 2, свидетельствуют о наличии Са и Sr в интервале 175–195 nm, т.е. в диапазоне толщин *M*-прослойки, оцененной по числу импульсов лазерной абляции с помощью калибровки скорости роста пленки CSCO.

### 3. Электрофизические характеристики

На рис. 3 показаны зависимости удельного сопротивления  $\rho$  от температуры пленок CSCO с x = 0.15 и 0.5, осажденных на подложку NGO. Зависимости  $\rho(T)$  соответствуют трехмерной прыжковой проводимости с показателем степени при обратной температуре 1/4

$$\ln \rho(T) = \ln \rho_0 + (T_0/T)^{1/4}, \tag{1}$$

где  $T_0 = 24/(\pi k_B N_F a^3)$  — экспериментальный параметр [12],  $N_F$  — плотность состояний на уровне Ферми,



**Рис. 3.** Температурные зависимости удельного сопротивления пленок CSCO (x = 0.5 и x = 0.15). Пунктиром показаны экстраполяции  $\rho \sim T^{1/4}$ . На вставке те же зависимости приведены в линейном масштабе по температуре.



**Рис. 4.** Температурная зависимость сопротивления МГС с толщиной прослойки 20 nm и  $L = 10 \,\mu$ m. На вставке показана зависимость характерного сопротивления  $R_NA$  от толщины прослойки СSCO (x = 0.5) при T = 4.2 К. Темные символы выделяют случай отсутствия магнитной прослойки. Крестики соответствуют МГС с  $L = 10 \,\mu$ m, кружки — с  $L = 20 \,\mu$ m, треугольники — с  $L = 30 \,\mu$ m, ромбы — с  $L = 40 \,\mu$ m, пентагоны — с  $L = 50 \,\mu$ m.

а — радиус локализации носителей,  $k_B$  — постоянная Больцмана. Для пленки CSCO с x = 0.5 получаем  $T_0 = 3 \cdot 10^6$  K, а удельное сопротивление  $\rho$  при низких температурах составляет  $10^4 \Omega \cdot \text{сm. Следует отметить,}$ что во всех исследованных пленках CSCO не было обнаружено металлического хода проводимости.

Сопротивление (*R*) МГС представляет собой сумму сопротивлений YBCO-электрода, *M*/YBCO-границы, *M*-прослойки, барьера между *M*-прослойкой и Au, электрода Nb/Au: *R<sub>Y</sub>*, *R<sub>M/Y</sub>*, *R<sub>M</sub>*, *R<sub>b</sub>*, *R*<sub>Nb/Au</sub> соответственно. На рис. 4 представлена температурная зависимость сопротивления R(T) МГС с  $d_M = 20$  nm,  $x = 0.5, L = 10 \,\mu$ m. Удельное сопротивление металлического электрода Nb/Au при комнатной температуре составляет величину порядка  $ho_{
m Nb/Au} = 10^{-5} \, \Omega \cdot {
m cm}$ при толщине  $d_{\text{Nb/Au}} = 120 \,\text{nm}$ , поэтому при температурах ниже критической температуры ҮВСО-электрода (T < T<sub>C</sub>) вклад сопротивления R<sub>Nb/Au</sub> мал. При температурах ниже критической температуры электрода Nb/Au  $T_{C'} = 8 - 9$  К сопротивление  $R_{\text{Nb/Au}} = 0$ . При температурах  $T > T_C$  зависимость R(T) МГС аналогична зависимости  $R_Y(T)$  YBCO-пленки, измеренной отдельно. Видно, что с уменьшением температуры после перехода YBCO в сверхпроводящее состояние (в приведенном случае при  $T_C \cong 62 \,\text{K}$ ) при  $T_{C'} < T < T_C$  наблюдается участок R(T) с практически неизменной величиной сопротивления  $R = R_{M/Y} + R_M + R_b$ . Принимая во внимание эпитаксиальный рост двух купратов CSCO/YBCO и близкие параметры их кристаллических решеток, полагаем, что сопротивление  $R_{M/Y}$  мало́ по сравнению с  $R_b$ . Соответственно на светлопольном изображении (рис. 1) хорошо виден цветовой контраст границ CSCO/Au, в то время как граница YBCO/CSCO слабо отличима. На вставке к рис. 4 показана зависимость R<sub>N</sub>A от толщины *d<sub>M</sub>* для МГС, в которых наблюдается эффект Джозефсона (*R<sub>N</sub>* — сопротивление в нормальном состоянии, измеренное при напряжении  $V \sim 1.5 \,\mathrm{mV}$   $(T = 4.2 \,\mathrm{K})$ ,  $A = L^2$  — площадь МГС). Из данных, представленных на рис. 3, видно, что удельное сопротивление  $\rho_M$  автономной CSCO пленки (x = 0.5) растет с понижением температуры. При температуре *T* = 4.2 К ожидаемый вклад в  $R_N A = \rho_M d_M$  МГС от сопротивления пленки СSCO должен составить величину более  $10^4 \mu \Omega \cdot cm^2$ . Однако для МГС с относительно тонкой прослойкой  $d_M < 20 \, {\rm nm}$ таких больших значений R<sub>N</sub>A не наблюдалось. Более того, по сравнению с автономной пленкой CSCO сопротивление МГС в интервале  $T_{C'} < T < T_C$  слабо зависит от температуры. Следовательно, основной вклад в сопротивление МГС при низких температурах и малых толщинах прослойки вносит граница CSCO/Au. Как видно из зависимости на вставке к рис. 4, характерное сопротивление *R<sub>N</sub>A* образцов экспоненциально растет с увеличением  $d_M$ :  $R_N A = A_R \exp(d_M/a_R)$ . Подгоночные параметры были вычислены по методу наименьших квадратов и составили  $a_R = 8.5 \,\mathrm{nm}, A_R = 0.184 \,\mu\Omega \cdot \mathrm{cm}^2$ . Полученные данные показывают, что при толщине прослойки  $d_M < 40 \,\mathrm{nm}$  значения  $R_N A$  меньше, чем в структурах без М-прослойки ( $d_M = 0$ ). Если бы основной вклад в сопротивление МГС был от сопротивления СSCO прослойки, то величина R<sub>N</sub>A линейно увеличивалась бы с  $d_M$ , однако этого не наблюдается в эксперименте.

Дополнительную информацию об электрических свойствах прослойки и границы YBCO/Au можно извлечь из зависимости изменения емкости (*C*) МГС от толщины  $d_M$ . Вольт-амперные характеристики (BAX) джозефсоновских МГС при T = 4.2 К обнаруживали гистерезис (см. вставку к рис. 5). Емкость определялась из величины параметра МакКамбера  $\beta_C = 4\pi e I_C R_N^2 C/h$ , который



**Рис. 5.** Зависимость нормированной толщины барьра  $(d_0/\varepsilon)$  от толщины прослойки  $(d_M)$  Са<sub>1-x</sub>Sr<sub>x</sub>CuO<sub>2</sub> для x = 0.5. Линиями показаны аппроксимационные зависимости. На вставке приведена ВАХ МГС с толщиной прослойки Са<sub>1-x</sub>Sr<sub>x</sub>CuO<sub>2</sub>  $d_m > 20$  nm. Стрелки соответствуют критическому току и току "возврата".

однозначно связан с отношением тока возврата к критическому току ВАХ джозефсоновского перехода [13]. Для планарной геометрии МГС емкость  $C = \varepsilon_0 \varepsilon A/d_0$ , где  $\varepsilon_0$  — диэлектрическая проницаемость вакуума,  $\varepsilon$  — диэлектрическая проницаемость барьерного слоя CSCO/Au,  $d_0$  — толщина барьера. На рис. 5 показана зависимость  $d_0/\varepsilon$  от толщины  $d_M$  CSCO-прослойки. Видно, что при  $d_M \leq 20$  nm изменение емкости незначительно и величина  $d_0/\varepsilon$  (для серий МГС с  $d_M = 12$  и 20 nm) в пределах ошибки совпадает со случаем гетероструктур без прослойки:  $d_0/\varepsilon = 0.35 \pm 0.2$  nm.

Наличие гистерезиса в гетероструктурах без прослойки [14] свидетельствует об образовании барьерного слоя на границе YBCO/Au, что определяет величину емкости между электродами YBCO и NbAu. В случае же МГС барьерный слой образуется на границе CSCO/Au. Проанализируем, какую роль при этом играет слой CSCO. При  $d_M > 20 \,\mathrm{nm}$  наблюдается рост  $d_0/\varepsilon$ на нескольких сериях МГС. По методу наименьших квадратов для участка роста получаем линейную зависимость  $d_0/\varepsilon = (0.36 \pm 0.05)[d_M - (20 \pm 4)]$  nm. Такая зависимость  $d_0/\varepsilon$  от  $d_M$  описывается моделью, по которой из-за влияния YBCO на границе CSCO/YBCO образуется проводящий слой, который не вносит вклада в емкость C. Над проводящим слоем CSCO (толщиной до 20 nm) располагается слабопроводящая часть CSCO-прослойки толщиной  $d_0$ , определяющая емкость МГС. Отметим, что, хотя характерные сопротивления *R<sub>N</sub>A* МГС и гетероструктур без *М*-прослойки различаются почти на порядок (см. вставку к рис. 4), величины  $d_0/\varepsilon$  практически равны при  $d_M < 20 \,\mathrm{nm}$ . Ранее возникновение проводящего слоя (толщиной до 50 nm) наблюдалось для других купратов на границе PrBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>/YBCO [15]. Известно, что в тонких пленках

CSCO из-за нестехиометрии по кислороду может происходить перестройка электронной подсистемы [16-18]. Как показано в [16], несмотря на слабую диффузию катионов (1-2 атомных ячейки), изменение проводимости контактирующих материалов на границе раздела двух оксидов может быть вызвано электронной перестройкой, как это происходит на границе сильно коррелированного моттовского изолятора и изолятора со щелью в спектре возбуждений [16]. Зарядовая перестройка из-за уменьшения содержания кислорода в пленке в процессе ее роста [18] может привести к значительному изменению электронной подсистемы слоя CSCO и переходу в металлическое состояние. В пользу предположения, что основной вклад в сопротивление МГС вносит граница CSCO/Au, свидетельствуют различие проводимости и Ферми-скоростей контактирующих материалов, их разные кристаллографические параметры, а также наличие дефектов на границе.

При относительно больших  $d_M > 70$  nm происходило резкое изменение R(T) МГС (см. вставку к рис. 6). В этом случае вклад сопротивления барьера  $R_b$  уже невелик по сравнению с  $R_M$ , и сопротивление CSCOпленки дает экспоненциальный (с увеличением  $d_M$ ) вклад в  $R_NA$ .

В интервале температур T = 70-43 К наблюдалась зависимость, которая описывается (1), что характерно для прыжковой проводимости. Величина подгоночного параметра  $T_0 = 7 \cdot 10^5$  К оказалась в несколько раз меньше, чем для автономной пленки CSCO. Если длина прыжка  $2r \cong a (T_0/T)^{1/4}$  сравнивается с толщиной барьера  $d_0$ , то может произойти смена механизмов проводимости МГС, например переход от прыжковой



**Рис. 6.** Температурная зависимость характерного сопротивления МГС (x = 0.5,  $d_M = 80$  nm,  $L = 30 \,\mu$ m). Стрелкой показана температура  $T_{\rm VRH}$ , ниже которой находится интервал температур, соответствующий механизму проводимости (1) (пунктирная линия),  $T_0 = 7 \cdot 10^5$  К. На вставке показана температурная зависимость (в линейном масштабе) сопротивления той же МГС.

проводимости к туннелированию через локализованные состояния [12,19]. На рис. 6 эта температура, при которой длина прыжка 2r становится равной  $d_0$  и происходит смена механизмов проводимости, обозначена как  $T_{\text{VRH}}$ . Из данных, представленных на рис. 6, имеем  $T_{\text{VRH}} = 43$  К, и для  $d_M = 80$  nm, учитывая зависимость  $d_0/\varepsilon$  от  $d_M$  (рис. 5), получаем  $d_0 = 60$  nm и радиус локализации  $a \cong 5$  nm. Используя значения  $T_0$  и a из соотношения  $T_0 = 24/(\pi k_B N_F a^3)$ , определяем плотность состояний  $N_F = 10^{18} \text{eV}^{-1} \cdot \text{cm}^{-3}$ , что существенно ниже величины  $N_F$ , наблюдаемой в PrBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub> [15].

### 4. Заключение

Таким образом, в результате структурных, рентгеновских и электрофизических исследований гибридных мезагетероструктур на основе купратного сверхпроводника (YBCO) с прослойкой из купратного антиферромагнетика (CSCO) установлено, что при эпитаксиальном росте двух купратов YBCO и CSCO образуется граница раздела с высокой прозрачностью. В автономном случае, когда пленка CSCO нанесена непосредственно на подложку, материал прослойки является моттовским изолятором, имеющим прыжковую проводимость, однако на границе YBCO/CSCO происходит допирование пленки CSCO носителями на глубину порядка 20 nm до состояния, близкого к металлическому, что приводит к уменьшению удельного сопротивления МГС с СSCO-прослойки по сравнению с удельным сопротивлением автономной CSCO-пленки на два порядка. При толщинах прослойки выше 70 nm сопротивление МГС в определенном диапазоне температур имеет зависимость, типичную для прыжковой проводимости, по которой удается оценить характерную температуру прыжковой проводимости и плотность состояний на уровне Ферми для прослойки.

Авторы благодарны И.В. Борисенко, В.В. Демидову, А.В. Зайцеву, А. Калабухову, И.М. Котелянскому, А.М. Петржику за помощь в проведении эксперимента и полезные обсуждения.

### Список литературы

- [1] A. Buzdin. Rev. Mod. Phys. 77, 935 (2005).
- [2] F.S. Bergeret, A.F. Volkov, K.B. Efetov. Rev. Mod. Phys. 77, 1321 (2005).
- [3] V.V. Ryazanov, V.A. Oboznov, A.Y. Rusanov, A.V. Veretennikov, A.A. Golubov, J. Aarts. Phys. Rev. Lett. 86, 2427 (2001).
- [4] M. Flokstra, J. Aarts. Phys. Rev. B 80, 144513 (2009).
- [5] C. Bell, E.J. Tarte, G. Burnell, C.W. Leung, D.-J. Kang, M.G. Blamire. Phys. Rev. B 68, 144 517 (2003).
- [6] A. Gozar, G. Logvenov, L.F. Kourkoutis, A.T. Bollinger, L.A. Giannuzzi, D. Muller, I. Bozovic. Nature 455, 782 (2008).

- [7] А.В. Зайцев, Г.А. Овсянников, К.И. Константинян, Ю.В. Кислинский, А.В. Шадрин, И.В. Борисенко, Ф.В. Комиссинский. ЖЭТФ 137, 380 (2010).
- [8] Г.А. Овсянников, К.И. Константинян. ФНТ 38, 423 (2012).
- [9] Г.А. Овсянников, С.А. Денисюк, И.К. Бдикин, ФТТ 47, 417 (2005).
- [10] Ю.В. Кислинский, К.И. Константинян, Г.А. Овсянников, Ф.В. Комиссинский, И.В. Борисенко, А.В. Шадрин. ЖЭТФ 133, 914 (2008).
- [11] G.A. Ovsyannikov, K.Y. Constantinian, Yu.V. Kislinski, A.V. Shadrin, A.V. Zaitsev, A.M. Petrzhik, V.V. Demidov, I.V. Borisenko, A.V. Kalabukhov, D. Winkler. Supercond. Sci. Technol. 24, 055012 (2011).
- [12] Y. Xu, D. Ephron, M.R. Beasley. Phys. Rev. B 52, 2843 (1995).
- [13] H.H. Zappe. J. Appl. Phys. 44, 1371 (1973).
- [14] P.V. Komissinskiy, G.A. Ovsyannikov, K.Y. Constantinian, Y.V. Kislinski, I.V. Borisenko, I.I. Soloviev, V.K. Kornev, E. Goldobin, D. Winkler. Phys. Rev. B 78, 024 501 (2008).
- [15] M.I. Faley, U. Poppe, C.L. Jia, K. Urban. IEEE Trans. Appl. Supercond. 7, 2514 (1997).
- [16] S. Okamoto, A. Millis. Nature **428**, 630 (2004).
- [17] J.C. Nie, P. Badica, M. Hirai, J.Y. Kodama, A. Crisan, A. Sundaresan, Y. Tanaka, H. Ihara. Physica C 388–389, 441 (2003).
- [18] S.J.L. Billinge, P.K. Davies, T. Egami, C.R.A. Catlow. Phys. Rev. B 43, 10340 (1991).
- [19] U. Kabasawa, Y. Tarutani, M. Okamoto, T. Fukazawa, A. Tsukamoto, M. Hiratani, K. Takagi. Phys. Rev. Lett. 70, 1700 (1993).